

公益社団法人精密工学会 プラナリゼーションCMPとその応用技術専門委員会 第195回研究会開催のご案内

このたび、プラナリゼーションCMP専門委員会では、下記のとおり『リソグラフィ技術の現在と未来』のテーマにて、第195回オンライン研究会を開催いたします。会員各位の多数の皆様のご参加をお待ちしています。また、非会員の方のご参加も有料にて受け付けております。是非ご参加下さい。



日時：2021年12月10日（金）13:00～17:00

開催場所：オンライン（Web） [※参加用URLは当日、午前中にご案内致します](#)
[※Web注意事項を説明します。初参加の方は当日12:55にアクセス下さい。](#)

プログラム：

13:00～13:05 Web研究会操作説明・本日の進め方説明
13:05～13:10 開会挨拶（檜山委員長）

13:10～16:15 話題提供
テーマ：『リソグラフィ技術の現在と未来』

（議部幹事・宮嶋幹事）

1) 13:10～13:55 「リソグラフィの基礎と技術動向」

大阪大学教授 遠藤政孝氏

<概要>メモリー、マイクロセッサ等のデバイスの高集積化の要求は、携帯端末、情報機器等の高性能化に伴い、益々大きくなっている。リソグラフィは現在先端の量産で用いられているArF液浸、ダブル/マルチパターニングに加えて、待ち望まれていたEUVが用いられはじめている。

本講演では、リソグラフィの基礎を解説した後、現在の5nmロジックノードに用いられている最新技術をその要求特性、課題と対策をふまえて解説し、今後の技術展望についてまとめる。

2) 13:55～14:40 「EUVの量産適用状況とロードマップ」

ASML ジャパン 森崎健史氏

<概要>本講では、EUVリソグラフィの半導体量産適用状況をNXE:3400のフィールドデータと合わせて報告します。また今年の第2四半期にリリースされたNXE:3600の最新のデータも報告します。さらにASMLの最新のEUV露光装置ロードマップをご紹介します。次世代の高NA (NA = 0.55) EUVシステムの開発状況などを報告します。

14:40～14:50 休憩

3) 14:50～15:35 「EUV世代のダブルパターニング技術」

東京エレクトロン株式会社 小山賢一氏

<概要>先端ロジックの微細化はNA0.33 EUVリソグラフィ技術がけん引しているが、N3及びN2世代の量産にはHigh NAリソグラフィが間に合わない。そのためArF液浸露光で培われたダブルパターニング及びマルチパターニング技術を既存EUVリソグラフィへ適用させることが必須。今回、東京エレクトロンにおける多重露光プロセスのインテグレーション技術に関してご紹介する。

4) 15:35～16:20 「半導体をはじめとするナノデバイスへのナノインプリント応用」

兵庫県立大学名誉教授 松井真二氏

<概要>ナノインプリントは、光ディスク製作では良く知られているエンボス技術を発展させ、その解像性を高めた技術であり、凹凸のナノパターンを形成したモールドを基板上の液状ポリマー等へ押し付け、ナノパターンを転写するものである。10nmレベルのナノ構造体を、安価に大量生産でき、かつ高精度化が可能となりうる技術として近年注目を浴びている。本講演では、半導体へのリソグラフィ応用について説明すると共に、光デバイス等のナノ構造デバイスへの応用展開についても説明する。

【特別講演】

5) 16:20～16:50 「(続) 新型コロナ禍の情報発信に見るデータ解析とその見せ方の重要性」

株式会社 ISTL 磯部 晶氏

<概要>4月の研究会で新型コロナの感染拡大についてデータサイエンスの観点から解説を加え、政府や自治体、専門家、マスクの情報発信方法に問題があることを指摘した。今回はその続編として、その後の状況、特に第5波の急激な感染拡大とその後の急速な収束について、データや各種論文から読み解いていく。

16:50～17:00 連絡事項・閉会挨拶

参加費：

1. 企業会員：無料（年会費 100,000 円） ※今回は3名以上の参加も可
 2. 官学会員：無料（年会費無料・要登録） ※今回は3名以上の参加も可
 3. 非会員：30,000 円（今回の研究会のみの参加費）
- ※ご入会検討でお試し参加される場合、初回のみ一人様 15,000 円でご参加頂けます。
※人数確認のため会員方も必ず事前に申込書の提出をお願い致します。

※ 今回のオンライン研究会には Zoom を使用させていただきます（当委員会が有する正規ライセンスの有償版）。

2021年12月10日（金）開催 第195回オンライン研究会 参加申込書

会員 / 一般（いずれかにチェックしてください）

氏名				
勤務先・所属				
連絡先	住所			
	TEL		FAX	
	E-mail			

※ホームページからオンライン申し込みできます。

<http://www.planarization-cmp.org/registration>

問合せ先：「プラナリゼーションCMP 専門委員会」事務局（三上）
TEL：03-5117-2225, FAX：03-5117-2223, E-mail：mikami@global-net.co.jp